PAT-NO:

JP363136533A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63136533 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE

**PUBN-DATE:** 

**June 8, 1988** 

INVENTOR-INFORMATION: NAME KUROKAWA, ATSUSHI **MISHIMAGI, HIROMITSU** KAMATA, CHIYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP61281725

APPL-DATE: November 28, 1986

INT-CL (IPC): H01L021/52

US-CL-CURRENT: 438/601, 438/656, 438/FOR.352

## ABSTRACT:

PURPOSE: To mount a semiconductor pellet with a gold-tin alloy without varying the characteristics of a circuit element, etc., by applying and forming

an intermediate layer consisting of one selected from at least titanium, chromium and molybdenum onto the semiconductor surface of the pellet. CONSTITUTION: A pellet 3 joined by a gold-tin alloy layer 4 is brought into

contact with said gold-tin alloy layer 4 through an intermediate layer constituted of a first intermediate layer 9 applied onto the joint surface 3a of the pellet 3 and composed of titanium (Ti) and a second intermediate layer

10 applied to said first intermediate layer 9 and made up of nickel (Ni). To join the semiconductor pallet 3 to a package substrate 1, the semiconductor

pallet 3 in which a gold layer 11 is applied onto the second intermediate layer

10 applied onto the first intermediate layer 9 on the joint surface 3a is prepared, and heated at a fixed temperature under the state in which foil 4A

consisting of a gold-tin alloy is held between said gold layer 11 and the package substrate 1, and the pellet may be scrubbed.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

# ② 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 136533

@Int\_Cl\_4

識別記号

广内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)6月8日

H 01 L 21/52

A-8728-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②特 願 昭61-281725

**20出 願 昭61(1986)11月28日** 

砂発 明 者 黒 川 敦 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

砂発 明 者 三 島 木 宏 光 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

⑫発 明 者 鎌 田 千 代 士 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

切出 顋 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

### 明和音

- 発明の名称 半導体装置
- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 化合物半導体からなる半導体ペレットが、金 一鍋合金層を介してペレット取付基板に接合されてなる半導体装置であって、上記半導体ペレットの半導体面には、少なくともチタン、クロムまたはモリブデンからなる中間層が被着され、必要に応じて上記中間層には、銅、ニッケル・パラジウムまたは白金からなる第二中間層が被着されてなる半導体装置。
  - 2. 上記化合物半導体が、がリウム・ヒ衆単結晶であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の半導体装置。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体装置、特に搭載する半導体ベレットの取付けであるダイボンディングに適用して有効な技術に関する。

## 〔従来の技術〕

半導体装置では、一般に搭載する半導体ペレット (以下、単にペレットともいう。)をその取付基板であるパッケージ基板等に、種々の合金等を用いて接合する、いわゆるダイポンディングが行われている。その技術については、たとえば1980年1月15日、株式会社工業調査会発行「IC化実装技術」P100に説明がある。

ところで、半導体ペレットには、がりウム・ヒ 素(GaAs)単結晶等の化合物半導体で形成さ れてなるものがある。

上記半導体ペレットのダイボンディングを金ーのダイボンディングを金ーのダイボンディングを金ーに (AuーSn) 合金で行う場合は、その裏とに (位置する単結晶面(半導体面)が金ーの裏とにの 接着性が悪いので、予め上記ペレットの裏を ところが、レット を で を 強 で で を を を で を 変 面 と 金 層 と の 間 に 、 を で 、 上記ペレット 裏面と 金 層 と の 間 に 、 を 面 者の 接着を 可能に する 中間層 と して 金 ー ゲル

マニウム合金層を介在させることが考えられる。 (発明が解決しようとする問題点)

ところが、上配金ーゲルマニウム合金層で、ベレット裏面と金層とを接着するためには、たとえば360で以上の高温で熱処理をする必要があるが、該熱処理によりベレットの内部に形成されている回路第子等が特性変動を起こすという新たな問題のあることが本発明者により見出された。

本発明の目的は、回路素子等の特性変動をおこすことなく、金一錫合金で半導体ペレットの取付けを行うことができる技術を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

### (問題点を解決するための手段)

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次の通りである。

すなわち、化合物半導体からなる半導体ペレットを、金一錫合金層を介してペレット取付基板に接合してなる半導体装置であって、上記半導体ペ

第1 図(a) は本発明による一実施例である半導体装置の拡大部分断面図であり、第1 図 (b) は上記半導体装置に搭載する前の半導体ペレットの拡大部分断面図である。また、第2 図は上記半導体装置の概略を示す断面図である。

本実施例の半導体装置は、いわゆるチップキャリア型パッケージからなるものである。すなわち、パッケージ基板(ペレット取付基板) 1 が、その中央部に凹部からなるキャビティ 2 を有するセラミックで形成され、 抜キャビティ底部にはガリウム・ヒ素単結晶(化合物半導体)からなる半導体ペレット 3 が金一銀合金層 4 を介して接合されている。

また、上記パッケージ基板1の凹部には段差部 1aがあり、核段差部1aには、上記ペレットの MESFET等の回路素子が形成された一主表面 上のポンディングパッドとアルミニウム(Ae) からなるワイヤ5を介して電気的に接続されてい るメタライズ配線6が形成されている。上記メタ レットの半導体面(上記ペレット取付基板に接合される一主表面)には、少なくともチタン、クロムおよびモリブデンから選択された一つからなる中間層(金属層)を被着形成するものである。また、必要に応じて上記中間層に、銅、ニッケル、バラジウムおよび白金から選択された一つからなる第2中間層(第2中間層)を形成するものである。

#### (作用)

上記した手段によれば、、上記中間層または第2中間層が、高温の熱処理をせずとも物半導体とが、高温の熱処理をせずきを有りている。ということができ、結果と同いなる。というである。なお、中間層としては、高温熱にしている。なお、中間層としてのである。なお、中間層としてのといっている。なお、中間層としての過失される。は、本発明によりこの問題も同時に解決される。(実施例)

成されている実装用電極6aと、抜基板1の側部 に延在しまたは貫通し、その裏面にまで延在され ている配線を介して電気的に接続されている。

そして、上記キャピティ2は、バッケージ基板 1の上部改差部1 b にろう材 7 で取付けられているセラミックからなるキャップ 8 で気密封止されているものである。

本実施例の半導体装置においては、金ー錫合金層4で接合されているペレット3が、第1図(3)に示すように、その接合面(半導体面)3aに被着されたチタン(Ti)からなる第1中間層9と、該第1中間層9に被着されたニッケル(Ni)からなる第2中間層10とで構成される中間層を介して、上記金ー錫合金層4に接触されている。

上記半導体ペレット 3 をパッケージ基板 1 に接合するには、第 1 図 (2)に示すように、その接合面 3 a 上の第 1 中間層 9 上に被着されている第 2 中間層 1 0 上に金層 1 1 が破着されている半導体ペレット 3 を用意し、上記金層 1 1 とパッケージ基板 1 との間に金一場合金からなる箔 4 A を挟持し

た状態で所定温度に加熱し、スクラブすればよい。 この結果、金磨11の金は金一錫合金箔4A内に 主として拡散 (シンター) し、金ー錫合金層 4 を 形成する。また、金篇11の金は、第1および第 2 中間層 9 および 1 0 内にも拡散し、各層 4 . 9 . 10を接着する。なお、上記第1、第2中間層は、 スパッタ等の通常の蒸着技術で容易に形成するこ とができる。

このように、本実施例においては次の効果が得

(1) ガリウム・ヒ素単結晶からなるペレットの接 合面に、チタンからなる第1中間層9とニッケル からなる第2中間層10からなる中間層とを被着 形成することにより、上記中間層の表面が金層1 1との接着性に優れ、かつその金層 11が十分な 強度で披着されている半導体ペレット3を、高温 加熱処理を要せずして形成できるので、上記ペレ ット3を金-錫合金層4を介してパッケージ基板 1に接合しても核ペレット3の電気的特性に変動 を来すことを有効に防止できる。

結晶からなる半導体ペレットについて説明したが、 4. 図面の簡単な説明 これに限定されるものではなく、たとえばインジ ゥム・リン (InP) 単結晶等の他の化合物半導 体からなるペレットに適用しても有効な技術であ Α.

### [発明の効果]

本顧において開示される発明のうち代表的なも のによって得られる効果を簡単に説明すれば、下 記の通りである。

すなわち、化合物半導体からなる半導体ペレッ トを金ー錫合金層を介してペレット取付基板に接 合してなる半導体装置であって、上記半導体ペレ プトの半導体面には、少なくともチタン、クロム またはモリブデンからなる中間層を被着形成する ことにより、上記中間層が、高温の熱処理をせず とも化合物半導体と金との両者に対して十分な接 疫性を有しているので、上記半導体ペレットを高 温に加熱することなくその取付けを行うことがで き、結果として回路素子等に特性変動が起こるこ とを有効に防止できるものである。

(2). 上記(1)により、半導体装置の信頼性向上を達 成できる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に 基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな い範囲で種々変更可能であることはいうまでもな

たとえば、前記実施例では、第1中間層9がチ タン、第2中間層10がニッケルからなる中間層 について説明したが、第1中間層9はクロムまた はモリブデンのいずれかで形成することもでき、 また第2中間層10も銅。パラジウムまたは白金 のいずれかを用いて形成してもよい。

また、中間層が第1および第2の2層構造から なるものについて説明したが、これに限るもので なく、中間層をチタン、クロムまたはモリブデン のいずれかで形成された一層構造のものであって もよいことはいうまでもない。

以上の説明では主として本発明者によってなさ れた発明をその利用分野であるがりウム・ヒ素単

第1 図(a) は本発明による一実施例である半導体 装置の拡大部分断面図、

第1図b)は上記半導体装置に搭載する前の半導 体ペレットの拡大部分断面図、

第2図は上記半導体装置の概略を示す断面図で

1・・・パッケージ基板(ペレット取付基板)、 1 a. 1 b · · · 段差部、2 · · · キャビティ、 3 · · · 半導体ペレット、3 a · · · 接合面(半 導体面)、4・・・金ー錫合金層、5・・・ワイ ヤ、6・・・メタライズ配線、6a・・・実装用 置極、アン・・ろう材、8・・・キャップ、9・ ・・第1中間層、10・・・第2中間層、11・ ・・会間。

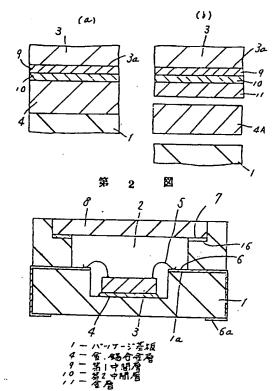
代理人 弁理士 小 川 勝



# 特開昭63-136533(4)

図面の浄書

第 1 図



手 稅 補 正 热 (水)

昭和 6 年 3 月 1 6 日

特許庁長官 殿

事件の表示

明和 61 年 特許蘭 第 281725 号

発明の名称

半海体装置

稲正をする者

事件との関係 特許出願人

名 栋 (510) 株式会社 日 立 製 作 所

代 鬼 人 ...

居 所 〒100 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

株式会社日立製作所内

**電話 東京 212-1111 (大代表)** 

氏 名 (6850) 弁理士 小 川 勝 :

補正命令の日付

昭和62年2月24日

補正の対象

明細書に添付した図面

補正の内容

別紙のとおり